

本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE 1 · · · · / ·

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日Date of Application:2000年 8月10日出願番号Application Number:特願2000-243183

出 願 人 Applicant(s):

キヤノン株式会社

2001年 8月24日



出証番号 出証特2001-3075844

| 【書類名】 | 特許願 |
|-----------|--|
| 【整理番号】 | 4266073 |
| 【提出日】 | 平成12年 8月10日 |
| 【あて先】 | 特許庁長官殿 |
| 【国際特許分類】 | H04N 5/32 |
| 【発明の名称】 | 放射線撮像装置および放射線撮像システム |
| 【請求項の数】 | 8 |
| 【発明者】 | |
| 【住所又は居所】 | 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会 |
| | 社内 |
| 【氏名】 | 梶原 賢治 |
| 【発明者】 | |
| 【住所又は居所】 | 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会 |
| | 社内 |
| 【氏名】 | 浜本 修 |
| 【特許出願人】 | |
| 【識別番号】 | 000001007 |
| 【氏名又は名称】 | キヤノン株式会社 |
| 【代表者】 | 御手洗 富士夫 |
| 【代理人】 | |
| 【識別番号】 | 100065385 |
| 【弁理士】 | |
| 【氏名又は名称】 | 山下穰平 |
| 【電話番号】 | 03-3431-1831 |
| 【手数料の表示】 | |
| 【予納台帳番号】 | 010700 |
| 【納付金額】 | 21,000円 |
| 【提出物件の目録】 | |
| 【物件名】 | 明細書 1 |
| | 【整理番号】 【提出日】 【あて先】 【国際特許分類】 【発明の名称】 【発明の名称】 【第明者】 【住所又は居所】 【住所又は居所】 【住所又は居所】 【氏名】 【代名】 【代名】 【代名】 【代名】 【代名】 【代名】 【代書許出願人】 【代表者】 【代書許出願人】 【代書許出願人】 【代書許出願人】 【代書子】 【代名又は名称] 【代理人】 【代理人】 【代理人】 【代理人】 【代理人】 【前別番号】 【代理人】 【代理人】 【前別番号】 【代理人】 【代理人】 【前別番号】 【行理二] 【氏名又は名称] 【非理二] 【氏名又は名称] |

 【物件名】
 図面
 1

 【物件名】
 要約書
 1

 【包括委任状番号】
 9703871

【プルーフの要否】 要

-

.

.

【書類名】 明細書

【発明の名称】 放射線撮像装置および放射線撮像システム

【特許請求の範囲】

【請求項1】 放射線を光に変換する波長変換手段と、該光を電気信号に変換する光電変換手段と、該波長変換手段と該光電変換手段との間にあって該波長変換手段からの光を該光電変換手段に導く、放射線遮蔽が可能な導光手段とを備えた放射線撮像装置において、

前記導光手段は複数の導光基体を繋ぎ部材を介して繋ぐことで構成され、該導 光基体は、該繋ぎ部材に入射した、前記波長変換手段を透過した前記放射線の一 部が、該導光基体の繋ぎ側の端部を通過するような形状とされていることを特徴 とする放射線撮像装置。

【請求項2】 請求項1に記載の放射線撮像装置において、前記導光基体の 繋ぎ側の端部は隣接する前記導光基体どうしが噛み合うような形状とされている ことを特徴とする放射線撮像装置。

【請求項3】 放射線を光に変換する波長変換手段と、該光を電気信号に変換する光電変換手段と、該波長変換手段と該光電変換手段との間にあって該波長変換手段からの光を該光電変換手段に導く、放射線遮蔽が可能な導光手段とを備えた放射線撮像装置において、

前記導光手段は複数の導光基体を繋いで構成され、該導光基体の繋ぎ面が前記 波長変換手段を透過した前記放射線の一部に対して非平行な面を有することを特 徴とする放射線撮像装置。

【請求項4】 請求項3に記載の放射線撮像装置において、前記非平行な面 は前記波長変換手段を透過した前記放射線の一部に対して一定の傾きを有する面 であることを特徴とする放射線撮像装置。

【請求項5】 請求項3に記載の放射線撮像装置において、前記非平行な面 は前記波長変換手段を透過した前記放射線の一部に対して段差を形成する面であ ることを特徴とする放射線撮像装置。

【請求項6】 請求項3~5のいずれかの請求項に記載の放射線撮像装置に おいて、前記導光基体の繋ぎ面は隣接する前記導光基体どうしが噛み合うような

形状とされていることを特徴とする放射線撮像装置。

【請求項7】 請求項1~6のいずれかの請求項に記載の放射線撮像装置において、前記導光基体はファイバープレートである放射線撮像装置。

【請求項8】 請求項1~7のいずれかの請求項に記載の放射線撮像装置と

前記放射線撮像装置からの信号を処理する信号処理手段と、

前記信号処理手段からの信号を表示するための表示手段と、

前記放射線を発生させるための放射線源と、を

具備することを特徴とする放射線撮像システム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、放射線撮像装置、それを備えた放射線撮像システム及びそれに備え られたファイバープレート基体に関し、特に、放射線を光に変換する変換手段と 、光を電気信号に変換する光電変換素子と、変換手段からの光を光電変換素子へ 導くファイバープレートとを備えた放射線撮像装置、それを備えた放射線撮像シ ステム及びそれに備えられたファイバープレート基体に関する。

[0002]

【従来の技術】

放射線撮像装置、特に医療を目的とするX線撮影装置ではX線動画が可能で画像品位が優れ、かつ、薄型で大面積入力範囲を有するX線撮像装置が求められている。また医療用のみならず、産業用非破壊検査機などにも薄型で安価な大面積のX線撮像装置が求められている。

[0003]

このようなX線撮像装置としては、例えば、(1)ファイバープレートのファ イバ繊維に傾斜を設けCCDセンサの非受光部(周辺回路)が干渉しあうことを 防ぎ大面積化したX線検出装置(例えば、米国特許第5,563,414号)、(2)フ ァイバープレートの厚みに段差をつけてCCDセンサの非受光部が干渉しないよ うに大面積化したX線検出装置(例えば、米国特許第5,834,782号)などがある

[0004]

上記(1)の構成のX線検出装置の概略的断面図を図15に示す。図15には 、X線を可視光に変換するシンチレータなどからなる蛍光体3と、蛍光体3によ って変換された可視光を撮像素子1側へ導く光ファイバなどのファイバープレー ト2と、ファイバープレート2によって変換された可視光を電気信号に変換する 撮像素子1とを示している。

[0005]

このX線撮像装置は、ファイバープレート2を撮像素子1に対して傾斜を設け ており、ファイバープレート2間には、各撮像素子1からの電気信号を処理する 処理回路等が設けられている。

[0006]

上記(2)の構成のX線検出装置の概略的斜視図を図16に示す。図16にお いて、図15と同様の部分には、同一の符号を付している。図16に示すように 、ファイバープレート2の長さを変えて、たとえば3つの撮像素子1を一組とし て各組毎に段差を設けることによって、各撮像素子1に処理回路等を備えられる ようにしている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】

しかし、上記(1)の構成は、まず、斜めにファイバープレートを切断するた め、ファイバープレートの加工が困難なこと、加えてロット当りの取り個数が少 なくなるので価格が高くなるといった問題がある。また、傾斜を設けると、ファ イバープレートの各ファイバーで光の伝送効率が悪くなりセンサーの感度が低下 する。さらに、図示したものは2×2ブロックのファイバープレートを貼り合わ せたもので、現有するファイバープレートを使用すると100×100mm程度 の大きさが限界である。しかるにファイバーの傾斜を変えて3×3等にすると、 各撮像素子内の画素のうち、中央に配置しているファイバープレートよりも、周 辺に配置しているファイバープレートの方が光の透過率が劣り、各撮像素子から 出力される信号にムラが生じる。また、上記(2)の構成は、X線撮像装置が大

型化するという問題がある。また、各段差部分と撮像素子との位置合わせ精度が 厳しいため、製造工数が多くなり、且つ高精度な位置あわせ装置が必要になる。 これらを鑑みると上記(2)の構成は現実的ではない。

[0008]

上記従来のX線撮像装置では、X線撮像装置の大型化、低コスト化、製造工程 での作業性等の要請に対して必ずしも十分なものではなかった。

[0009]

本発明の目的は、X線撮像装置の大型化、低コスト化に適し、製造工程での作 業性により優れた放射線撮像装置及び放射線撮像システムを提供することにある

[0010]

【課題を解決するための手段】

本発明の放射線撮像装置は、放射線を光に変換する波長変換手段と、該光を電 気信号に変換する光電変換手段と、該波長変換手段と該光電変換手段との間にあ って該波長変換手段からの光を該光電変換手段に導く、放射線遮蔽が可能な導光 手段とを備えた放射線撮像装置において、

前記導光手段は複数の導光基体を繋ぎ部材を介して繋ぐことで構成され、該導 光基体は、該繋ぎ部材に入射した、前記波長変換手段を透過した前記放射線の一 部が、該導光基体の繋ぎ側の端部を通過するような形状とされていることを特徴 とするものである。

[0011]

また本発明の放射線撮像装置は、放射線を光に変換する波長変換手段と、該光 を電気信号に変換する光電変換手段と、該波長変換手段と該光電変換手段との間 にあって該波長変換手段からの光を該光電変換手段に導く、放射線遮蔽が可能な 導光手段とを備えた放射線撮像装置において、

前記導光手段は複数の導光基体を繋いで構成され、該導光基体の繋ぎ面が前記 波長変換手段を透過した前記放射線の一部に対して非平行な面を有することを特 徴とするものである。

[0012]

本発明の放射線線撮像システムは、上記本発明の放射線撮像装置と、

前記放射線撮像装置からの信号を処理する信号処理手段と、

前記信号処理手段からの信号を表示するための表示手段と、

前記放射線を発生させるための放射線源と、を具備することを特徴とするものである。

[0013]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。なお、本発明の放 射線撮像装置は以下に説明するX線撮像装置に好適に用いることができるが、特 にその用途がX線撮像装置に限定されず、α,β,γ線等のX線以外の放射線を 検出する放射線撮像装置に用いることができる。

[0014]

(実施形態1)

図1は本発明のX線撮像装置の一実施形態の平面図、図2はその断面図である 。図1及び図2には、X線を可視光等の撮像素子で検知可能な波長の光に変換す る波長変換手段としての蛍光体3と、蛍光体3によって変換された光を撮像素子 側へ導く複数の(導光基体となる)ファイバープレート2dを繋いだ(導光手段 となる)ファイバプレート基体2と、ファイバープレート2dを相互に接着する (繋ぎ部材となる) 接着材7と、ファイバープレート基体2と複数の画素を備え た撮像素子(光電変換基体)1とを接着する弾性に優れた透明接着材6と、光を 電気信号に変換する撮像素子1と、撮像素子1からの電気信号を外部に出力する フレキシブル基板4と、フレキシブル基板4と撮像素子1とを電気的に接続する バンプ5と、蛍光体3を保護するアルミ保護シート8と、撮像素子1を搭載する ベース基板10と、ベース基板10を保持するためのベース筐体11と、ベース 筐体11に備えられた筐体カバー9と、撮像素子1とファイバープレート2dと の間に設けられた一定間隔を保持するためのスペーサ13と、透明接着材6をフ アイバープレート2dと撮像素子1との間に介在させるための目地うめ接着材1 4 とを示している。X線撮像装置は、撮像素子1とファイバープレート基体2と を、透明接着材6によって貼り合わせることによって、形成している。撮像素子

出証特2001-3075844

1は複数の画素が2次元状に配置されてなり、CCDやCMOSセンサ等から構成される。ファイバープレート2dには鉛等の放射線遮蔽が可能な材料が含まれ ており、蛍光体3から漏れたX線を遮蔽する機能を有する。撮像素子1は行列状 にベース基板10上に配置され、光電変換手段を構成する。

[0015]

上記のX線撮像装置は、複数個のファイバープレート2dを透明接着材6によ る接着により貼り付け大判化し、さらに、大判化したファイバープレートに複数 の撮像素子を搭載するベース基板を貼り付けたものである。このように、接着に より大判化したファイバープレート、額縁を持たない撮像素子と蛍光体とをもち いることで、

1) 大面積検出装置を製作することができる。

2) 安価の大判ファイバープレートを製作できる。

3) ファイバ繊維を曲げたり傾けたりしないので光の利用効率が高い。

4) 最小限のファイバ厚みで構成できる。

5)ファイバ形状にセンサを合せこむ必要がない。

6)ファイバープレートの製造が容易である。

7) 蛍光体に成長ムラがないことから画像にムラのない良好な画質がえられる。

【0016】

以上のような作用効果を生みX線動画が可能で画像品位に優れ、かつ、薄型で 信頼性の高い大面積入力範囲を有するX線撮像装置を提供することができる。し かも安価となる。

[0017]

ここで、比較例となる図3及び図4のX線撮像装置との比較において、上記図 1及び図2に示した本実施形態のX線撮像装置の特徴について説明する。

[0018]

図3及び図4に示すように、ファイバープレートの繋ぎ目であるファイバ接着 部が撮像素子(光電変換基体)の周辺画素上に重なるように配置された場合には 、ファイバープレート2dを貼り合わせるファイバ接着部(繋ぎ目)7aはファ イバープレート2dと光透過率が異なり、このファイバ接着部7a下に撮像素子

出証特2001-3075844

1の画素列が配置されるとライン欠陥となる。また、蛍光体から光に変換されないで透過された漏れX線が貼り合わせ接着部を通して撮像素子に入射するとライン状にショットノイズが生じ画像品位を低下させることになり、さらに素子の劣化を引き起こし信頼性の問題が残る。なお、図3はファイバープレートの繋ぎ目であるファイバ接着部が撮像素子の周辺画素上に重なるように配置された場合を示す平面図、図4はその断面図である。なお周辺画素は後述するように、通常画素の大きさよりも小さくなっている。

[0019]

図1及び図2に示したX線撮像装置においては、ファイバープレートの繋ぎ部 材となる接着材7に入射した漏れX線がファイバープレートの繋ぎ側端部を通過 するようにファイバープレートの端部を加工し、撮像素子に漏れX線が入らない ようにした。漏れX線がファイバープレートの繋ぎ側端部を通過するようにする には、ファイバープレートの繋ぎ面が漏れX線に対して非平行な面を有すればよ く、ここではファイバープレートの側面(繋ぎ面)71が漏れX線に対して一定の 傾きを有するようにした。かかる構成を取ることで、図2に示すように、蛍光体 からの漏れX線はファイバープレートに入射し、ファイバープレートによりX線 が遮蔽され、X線がファイバープレートの繋ぎ目(接着材)から撮像素子に入射 しないようにしてライン状にショットノイズが生じないようにできる。

[0020]

なお、接着材7はファイバープレートとの熱膨張係数等の特性が等しい又は近 い材質のものが好ましい。

[0021]

以上説明した実施形態では、ファイバープレートの側面(繋ぎ面)71の全てが 漏れX線に対して一定の傾きを有するようにしたが、ファイバープレートの側面 (繋ぎ面)71の一部が漏れX線に対して一定の傾きを有するようにしてもよい。 図5は本発明のX線撮像装置の一実施形態の変形例の断面図である。図5に示す ように、ファイバープレートの側面(繋ぎ面)72は「く」の字状となっており、 ファイバープレートの側面(繋ぎ面)72の一部が漏れX線に対して一定の傾きを 有するようになっている。

[0022]

図6は本発明のX線撮像装置の一実施形態の他の変形例の断面図である。図6 に示すように、ファイバープレートの側面(繋ぎ面)73は段差状となっている。

[0023]

以上、ファイバープレートの側面(繋ぎ面)の形状の変形例を示したが、ファイ バープレートの側面(繋ぎ面)の形状は、接着材7に入射した漏れX線がファイバ ープレートの繋ぎ側端部を通過するようなものであれば、断面がジグザグ状、円 弧状等いかなる形状であってもよい。

[0024]

以下、図1と図2、図5、図6に示したX線撮像装置について更に説明する。

[0025]

図7は、撮像素子1の概略的な構成を示す平面図である。図7には、2次元配 列した、それぞれ光電変換素子を含む通常画素101と、駆動回路103の外側 に設けられた複数の周辺画素104と、各通常画素101及び各周辺画素104 を順次駆動する駆動回路103と、撮像素子1の入出力端子102とを示してい る。

[0026]

通常画素101は、ほぼ撮像素子1の全面に配しており、通常画素101のピッチは、後述するように、160μmとしている。通常画素101間には駆動回路103を分割して分散配置している。なお、周辺画素104は、通常画素10 1に比べて面積が小さいため、画素信号を補正処理することによって、面積の相 違がなくなるようにしている。

[0027]

図8(a)は、バンプ5及びフレキシブル基板4付近の概略的断面図、図8(b)は、図8(a)の平面図である。図8には、図1,図2に示した部材の他に 、バンプ5に接続されるフレキシブル基板4のインナーリード401と、撮像素 子1の端部とインナーリード401とのショートの防止及び撮像素子1の端部欠 損を防止するポリイミド樹脂層などの有機絶縁層105とを示している。

[0028]

特2000-243183

図9は、図8に示したバンプ5とフレキシブル基板4との電気的接続の様子を 示す図である。はじめに、有機絶縁層105としてたとえばポリイミド樹脂層を 25μmの厚さとなるように形成する。次に、バンプ5とフレキシブル基板4と の電気的接続を行うために、まず、撮像素子1の入出力端子102に、スタッド バンプ方式やメッキなどによりバンプ5を形成する。つぎに、有機絶縁層105 として、たとえばポリイミド樹脂層を25μmの厚さとなるように形成する。

【0029】

そして、バンプ5とインナーリード401とを、たとえば超音波により金属間 接合する。ちなみに、インナーリード401は、銅箔などをエッチングすること によって形成し、ニッケル及び金を用いてメッキを施して、18µm程度の厚さ とし、またフレキシブル基板の総厚は、50µm程度としている。

[0030]

次に、撮像素子1を保持台17,18によって保持した状態で、治具19を保 持台17,18の方向に移動させる。こうして、撮像素子1の端部でインナーリ ード401を図面下側に向けて90°程度曲げる。

[0031]

図10(a)は、撮像素子1のフレキシブル基板4付近の拡大図である。図1 0(b)は、図10(a)の平面図である。図10に示すように、X方向の長さ は周辺画素104の幅(S1)が通常画素101の幅(S2)より小さくなって おり(S1<S2)、各周辺画素104間のピッチ(P2)及び各通常画素10 1と各周辺画素104との間のピッチ(P1)は一定となるように配置されてい る(P1=P2=P)。さらに、各通常画素101間のピッチも同ピッチ(P) となるように配置されている。このことから、画素ピッチはすべて等ピッチとな り、画像品位は劣らない。

[0032]

図11は、撮像素子1とベース基板10との接着工程を示す図である。まず、 フレキシブル基板4を備えた複数の撮像素子1を、X,Y,Z方向及びθ(回転) う方向に可動するアライメントヘッド及びアライメントカメラを用いて位置合わ せしながらステージ上に載置する。このとき、各撮像素子1は、ステージに形成

出証特2001-3075844

されている孔からバキューム装置などで吸引されることによってステージ上に固 定される(図11(a))。

[0033]

この状態で、各撮像素子1が所要の動作を行うかどうかの検査を行う。この検 査では、検査治具を用いて、たとえば静電気などによって各撮像素子1が破壊さ れているかどうかなどを調べる(図11(b))。そして、検査の結果、撮像素 子1に欠陥が発見されれば、その撮像素子の下方のバキューム装置をオフして、 アライメントヘッドを用いて交換する(図11(c))。

[0034]

っづいて、撮像素子1上に、紫外線硬化型又はシリコーン樹脂などの接着材を 塗布する(図11(d))。そして、ベース基板10に設けられた長孔にフレキ シブル基板4を挿入して、それから撮像素子1とベース基板10とを密着させて 紫外線を照射したり加圧することによって接着する(図11(e))。なお、こ こでは、ベース基板10には、撮像素子1との間における熱膨張率などを考慮し て、ガラス又はパーマアロイ(鉄+ニッケル)合金を用いている。

[0035]

そして、撮像素子1とベース基板10とを接着した後に、バキューム装置をオ フにして、ステージなどの治具から撮像素子1及びベース基板10を取り外す(図11(f))。

【0036】

図12は、撮像素子1及びベース基板10とファイバープレート基体2とを貼 り合わせる工程の説明図である。なお、図12(a)及び図12(c)は、断面 図、図12(b)及び図12(d)は平面図としている。図11を用いて説明し たように、ベース基板10と接着した各撮像素子1上に、各撮像素子1とファイ バープレート基体2との間隔を保持できるように、スペーサ13を配置する(図 12(a))。スペーサーは球でも円柱形状でも良い。つぎに、シール材及び目 地うめ接着材を、撮像素子1上に塗布する(図12(b))。目地うめ接着材は 撮像素子1間の隙間を埋めるために充填されるものである。シール材は、図12 (b)に示すように一部が開口されており、後述するように、ここから真空注入

の方式を用いて透明接着材6を充填する。注入する際、真空リークの原因となら ぬように目地うめ接着材を撮像素子1間の隙間に充填している。

[0037]

それから、スペーサ13上に、ファイバープレート基体2を貼り合わせる(図 12(c))。更にファイバープレート基体2を相互に接着する接着材7が、各 撮像素子1間の隙間もしくは各画素間の直上に配置されるように行うとライン欠 陥を解消することができ、より好ましい。

[0038]

そして、真空チャンバ内で、ファイバープレート基体2と各撮像素子1との隙 間を真空状態にしたところで、透明接着材6を溜めたボートに開口部分をつけ真 空状態を大気圧に戻すことで、透明接着材6が隙間に充填される。その後、開口 部分を封止する(図12(d))。それから、たとえばシート上の蛍光体3をフ ァイバープレート基体2上に貼りつけることによって、X線撮像装置が形成され る。

[0039]

なお、蛍光体3はファイバープレート2上に蒸着する、もしくは粉末状の蛍光 体を結合材に混合させて塗布することによって設けることもできるが、この場合 、図12(c)を用いて説明した工程の前に、ファイバープレート基体2上に蛍 光体3を設けておく。

[0040]

っぎに、図1及び図2を用いてX線撮像装置の動作について説明する。蛍光体 3側に図示しないX線源を設置し、さらに、X線源とX線撮像装置との間に被写 体を位置させた状態で、X線源からX線を照射すると、そのX線は被写体に曝射 される。すると、X線は被写体を透過するときに強度差を有するレントゲン情報 を含んでX線撮像装置側に送られる。

[0041]

X線撮像装置側では、蛍光体3において、X線の強度に応じた可視光等の光に 変換される。変換されることで得られた光は、ファイバープレート基体2を通じ て撮像素子1側へ伝送される。このとき、ファイバープレート基体2と撮像素子

出証特2001-3075844

 $1 \ 1$

1とが透明接着材6によって接着されているため、光は透明接着材6を通過する ときに減衰することなく撮像素子1に入射される。

[0042]

また、光は、接着材7にも入射される。接着材7に入射した光は、ここで吸収 又は反射等されて光の透過率が小さくなる。この光が撮像素子1上に入射される とライン欠陥になるが、上述したように、本実施形態ではファイバープレート2 dの繋ぎ目の接着材7と撮像素子1の繋ぎ目もしくは各画素間との位置を合わせ ているので、接着材7からの光が撮像素子1の画素に影響を与えにくい構成とな っている。

[0043]

撮像素子1では、入射された光を、光の強度に応じた電気信号に変換する。こ の電気信号は、図示しない読み出し回路の指示に応じて、バンプ5を介してフレ キシブル基板4に読み出される。フレキシブル基板4に読み出された電気信号は 、図示しない外部回路基板に送られ、A/D変換された後に画像処理がされる。

[0044]

(実施形態2)

図13は、実施形態1で説明したX線撮像装置を備えた非破壊検査システムの 構成を示す概念図である。図13には、実施形態1で説明したX線撮像装置10 00と、たとえば電気機器に組み込まれる非破壊検査対象物である被写体200 0と、被写体2000にX線を照射するマイクロフォーカスX線発生器3000 と、X線撮像装置1000から出力される信号を処理する画像処理装置6000 と、画像処理装置6000によって処理された画像を表示するモニタ4000と 、画像処理装置6000及びモニタ4000を操作するコントローラ5000と を示している。

[0045]

図13に示す非破壊検査システムは、マイクロフォーカスX線発生器3000 によって発生されたX線を、非破壊検査を行いたい被写体2000に照射すると 、被写体2000の内部における破壊の有無の情報が、X線撮像装置1000を 通じて画像処理装置6000に出力される。画像処理装置6000では、出力さ

出証特2001-3075844

れた信号を、前述している各撮像素子1の周辺画素間の画像信号を処理したり、 ダーク補正などを施して、モニタ4000に画像として表示する。

[0046]

モニタ4000に表示されている画像は、コントローラ5000によって指示 を入力することで、たとえば拡大又は縮小したり、濃淡の制御等を行うことがで きる。こうして、モニタ4000に表示された画像を通じて、被写体2000の 内部における破壊の有無を検査する。そして、被写体2000に破壊が発見され なければ、それを良品とみなして電気機器に組み込む。一方、被写体2000に 破壊が発見されれば、それを不良品とみなして製造工程から除外する。

[0047]

(実施形態3)

図14は、実施形態1で説明したX線撮像装置を備えたX線診断システムの構 成を示す概念図である。図14には、X線撮像装置1000を備えたベッドと、 被写体2000にX線を照射するためのX線発生装置7000と、X線撮像装置 1000から出力される画像信号の処理及びX線発生装置7000からのX線の 照射時期等を制御するイメージプロセッサー8000と、イメージプロセッサー 8000によって処理された画像信号を表示するモニタ4000とを示している 。なお、図14において、図13で示した部分と同様の部分には、同一の符号を 付している。

[0048]

図14に示すX線診断システムは、X線発生装置7000は、イメージプロセ ッサー8000からの指示に基づいてX線を発生させ、このX線をベッド上の被 写体2000に照射すると、被写体2000のレントゲン情報がX線撮像装置1 000を通じてイメージプロセッサー8000に出力される。イメージプロセッ サー8000では、出力された信号を、前述している各撮像素子1の周辺画素間 の画像信号を処理したり、ダーク補正などを施して、図示しないメモリに格納し たり、モニタ4000に画像として表示する。

[0049]

モニタ4000に表示されている画像は、イメージプロセッサー8000によ

出証特2001-3075844

って指示を入力することで、たとえば拡大又は縮小したり、濃淡の制御等を行う ことができる。こうして、モニタ4000に表示された画像を通じて、医師が被 写体2000を診察する。

[0050]

なお、以上説明した本発明の各実施形態では、X線を用いた場合を例に説明し たが、α,β,γ線等の放射線を用いることができる。また、光は画素により検 出可能な波長領域の電磁波であり、可視光を含む。

【0051】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、導光基体の繋ぎ目を通しての漏れ放射 線(例えばX線)による影響を防止でき、より画像品位を向上させ、さらに素子 の信頼性を向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明によるX線撮像装置の一実施形態の平面図である。

【図2】

図1のX線撮像装置の断面図である。

【図3】

本発明に係わるX線撮像装置の比較例を示す、ファイバープレートの繋ぎ目で あるファイバ接着部が撮像素子の周辺画素上に重なるように配置された場合を示 す平面図である。

【図4】

図3のX線撮像装置の断面図である。

【図5】

本発明のX線撮像装置の一実施形態の変形例の断面図である。

【図6】

本発明のX線撮像装置の一実施形態の他の変形例の断面図である。

【図7】

撮像素子の概略的な構成を示す平面図である。

【図8】

バンプ及びフレキシブル基板付近の概略的断面図及びその平面図である。

【図9】

バンプとフレキシブル基板との電気的接続の様子を示す図である。

【図10】

撮像素子のフレキシブル基板付近の拡大図及び平面図である。

【図11】

(a)~(f)は、撮像素子とベース基板との接着工程を示す図である。

【図12】

(a)~(d)は、撮像素子1及びベース基板とファイバープレート基体とを 貼り合わせる工程の説明図である。

【図13】

本発明によるX線撮像装置を備えた非破壊検査システムの構成を示す概念図で ある。

【図14】

本発明によるX線撮像装置を備えたX線診断システムの構成を示す概念図である。

【図15】

従来のX線検出装置の第1例の概略的断面図である。

【図16】

従来のX線検出装置の第2例の概略的断面図である。

【符号の説明】

1 撮像素子(光電変換基体)

2 ファイバープレート基体(導光手段)

2d ファイバープレート(導光基体)

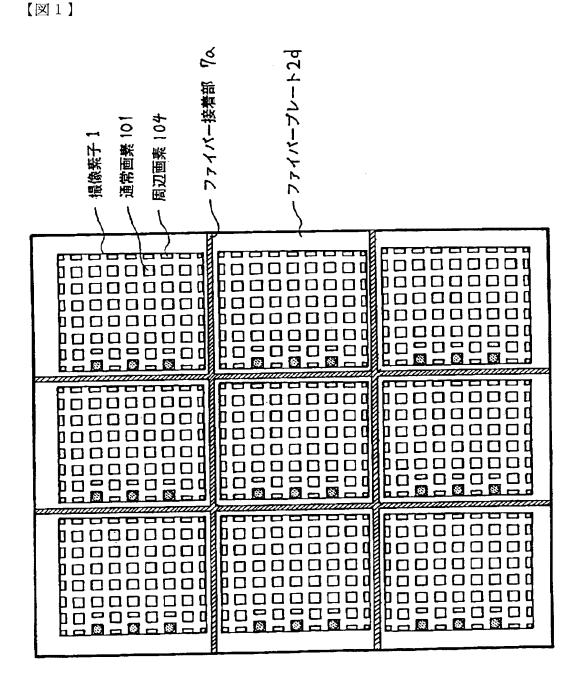
3 蛍光体(波長変換手段)

4 フレキシブル基板

5 バンプ

6 透明接着材

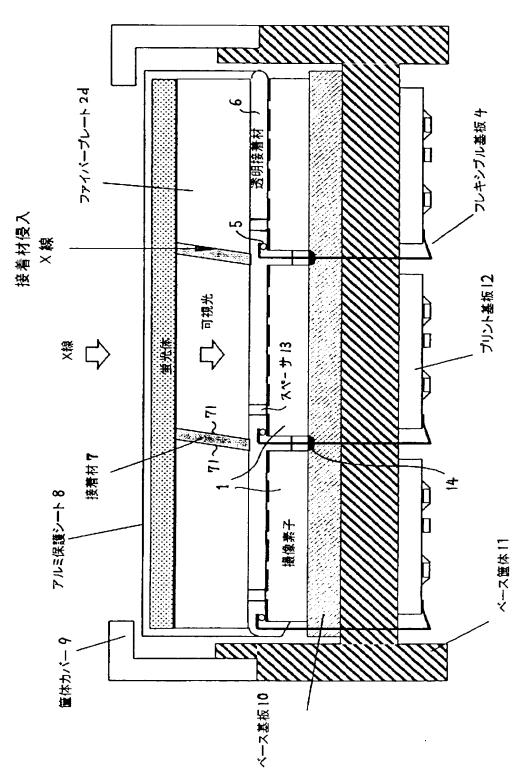
- 7 接着材
- 7 a ファイバ接着部
- 8 アルミ保護シート
- 9 筐体カバー
- 10 ベース基板
- 11 ベース筐体
- 13 スペーサ
- 14 目地うめ接着材



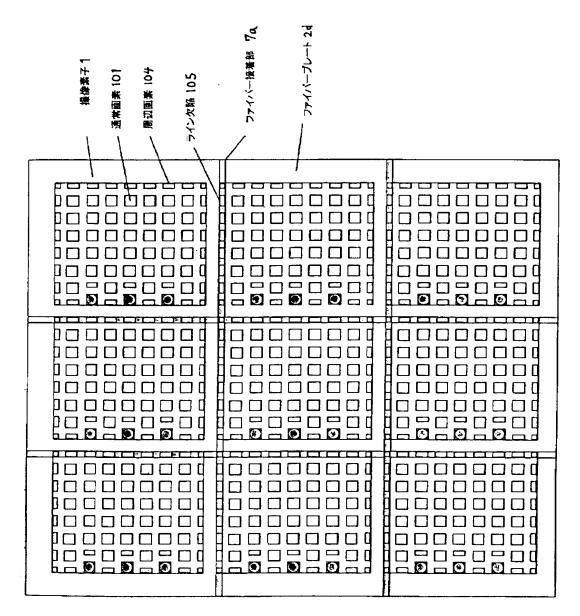
【書類名】

図面

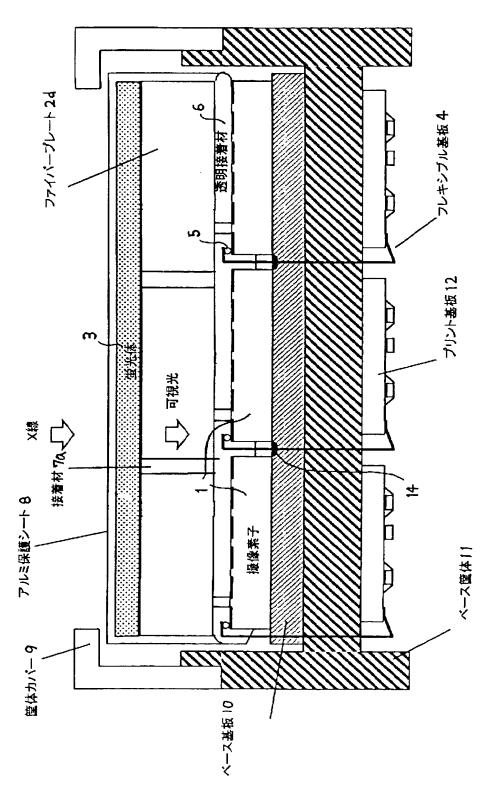
【図2】



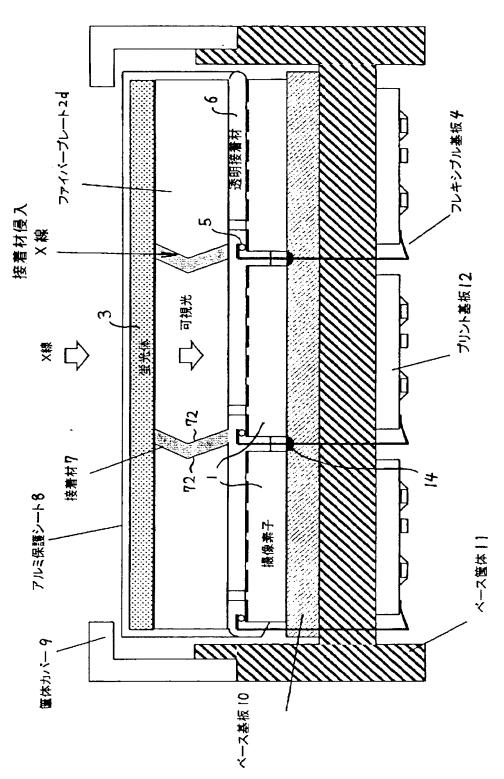
【図3】



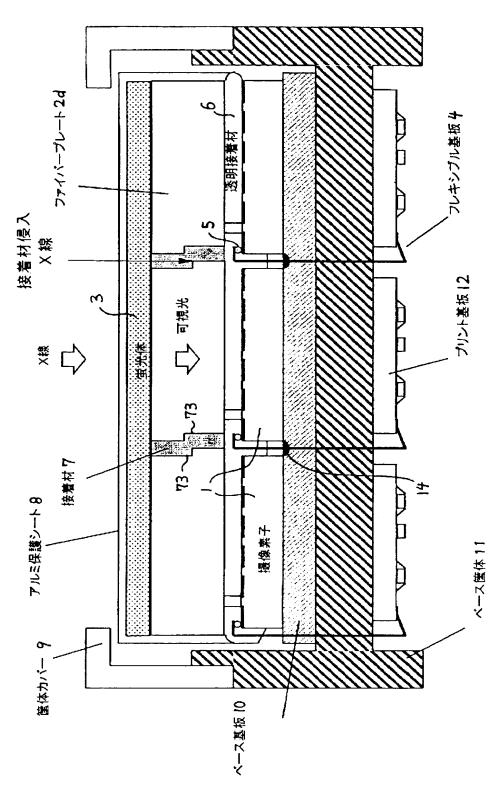
【図4】



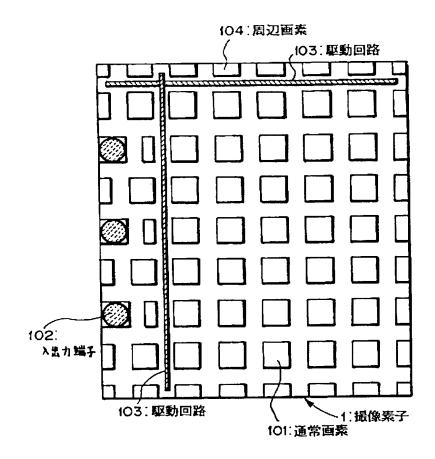
【図5】



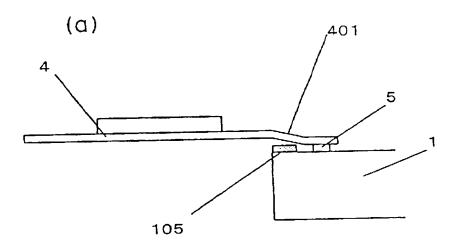
【図6】

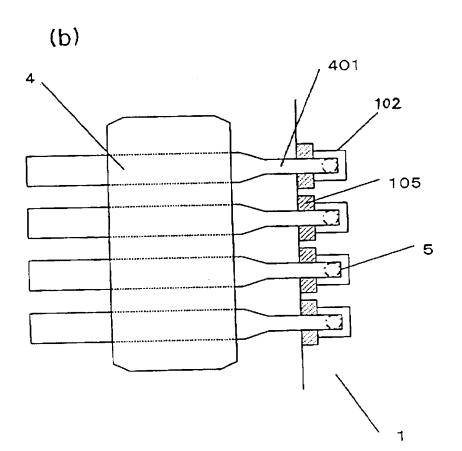


【図7】



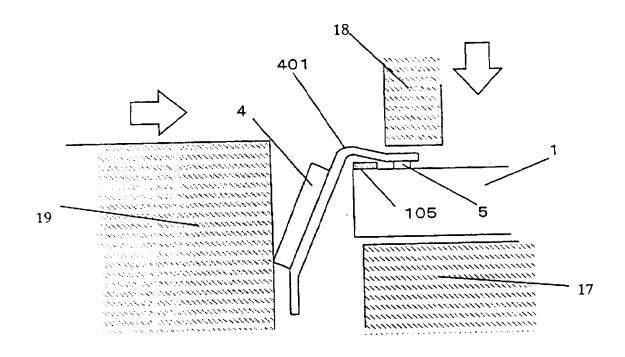
【図8】



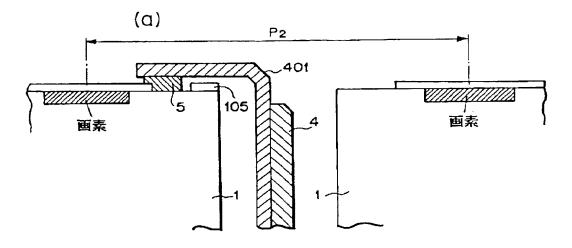


【図9】

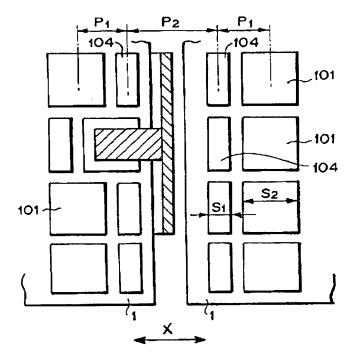
.



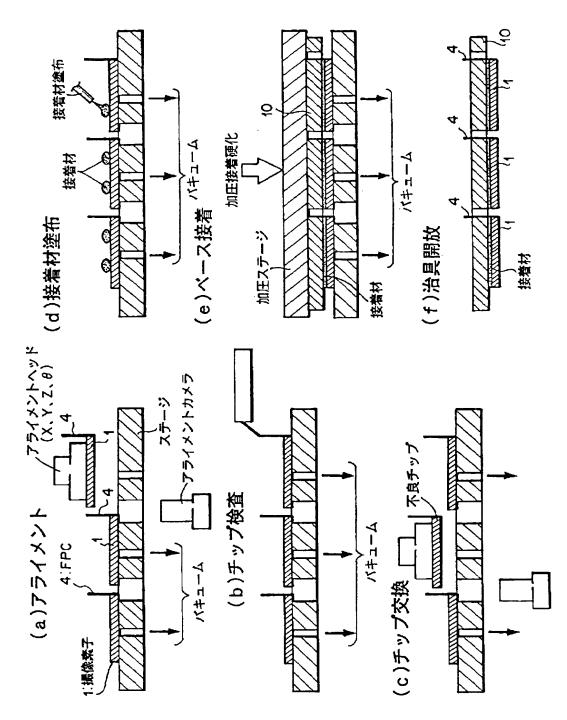
【図10】



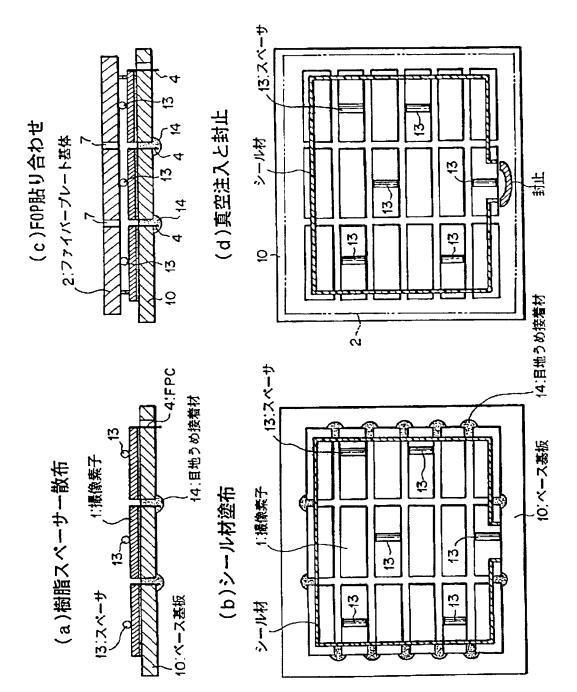
(b)



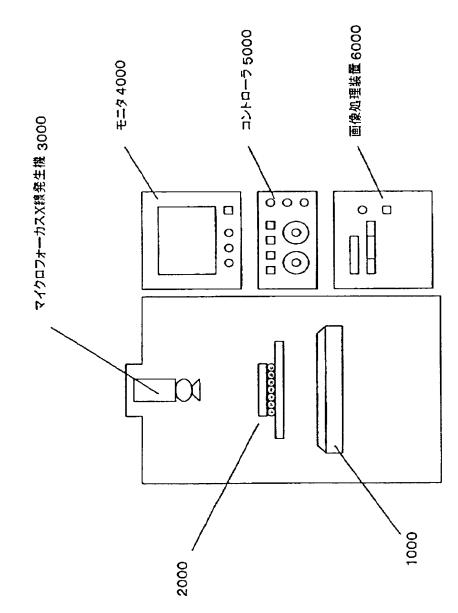
【図11】



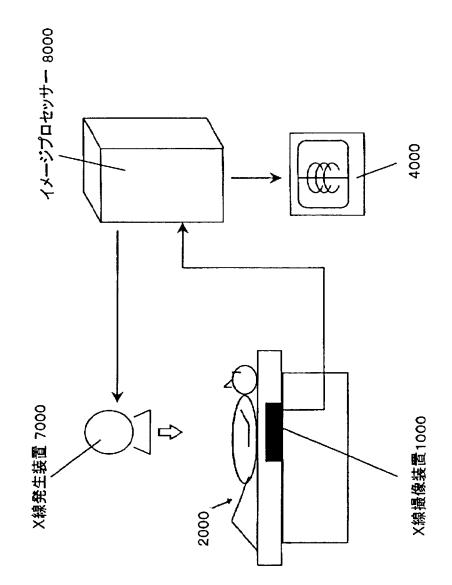
【図12】



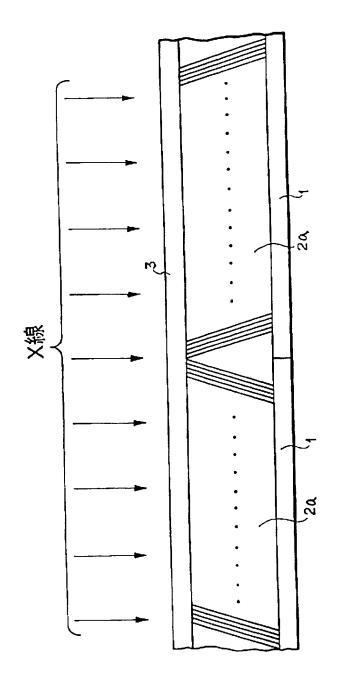
【図13】



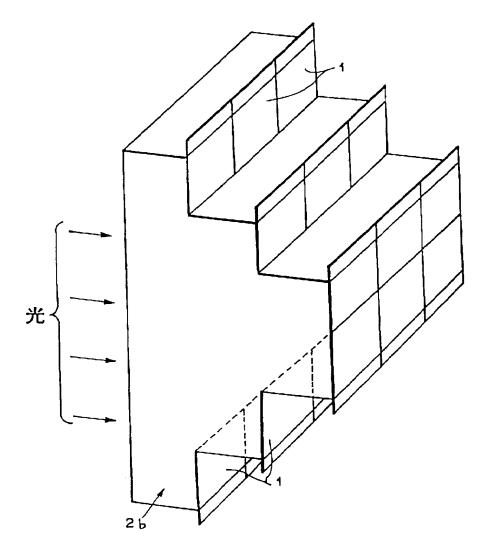
【図14】



【図15】



【図16】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 漏れX線によるショットノイズが生じないようにする。

【解決手段】 放射線を光に変換する蛍光体3、光を電気信号に変換する光電変換手段と、蛍光体3と光電変換手段との間にあって蛍光体3からの光を光電変換 手段に導く導光手段とを備えた放射線撮像装置において、導光手段は複数のファ イバープレート2dを接着材を介して繋ぐことで構成され、ファイバープレート 2dは、接着材に入射した、蛍光体3を透過した前記放射線の一部が、ファイバ ープレート2dの繋ぎ側の端部を通過するような形状とされている。

【選択図】 図2

特2000-243183

出願人履歴情報

識別番号 〔000001007〕

- 1. 変更年月日 1990年 8月30日
 - [変更理由] 新規登録

•

住 所 東京都大田区下丸子3丁目30番2号氏 名 キヤノン株式会社